

## 中国特許情報の実態

アジア特許情報研究会：伊藤徹男

## 1. 中国特許出願推移

中国専利（特許、実用新案、意匠）の出願推移を中国特許庁(CNIPA)が発表している統計情報<sup>1)</sup>を元にグラフ化すると図1のようになります。特許については2016年まで急上昇してきましたが、2017年以降横ばい状況です。実用新案は相変わらず急上昇を続けています。

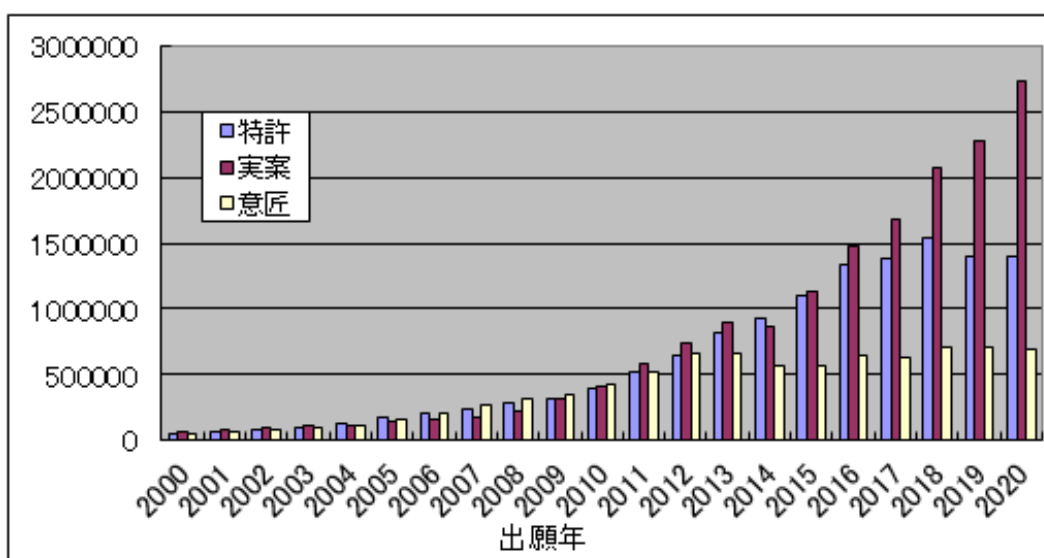


図1. 中国専利出願推移 (CNIPA 統計情報<sup>1)</sup>)

※ 2020年出願分は2021年2月11日現在、1月～11月分までしか公表されていないため2月末に修正予定。

CNIPA が公表した出願統計数値は変わることはありませんが、データベースに収録された公開特許数などを出願年基準で取得している場合には、毎週のデータ更新で積み上がり変化しますので、いつ取得したデータであるかを明らかにしておくことが重要です。(CNIPR では火曜、金曜にデータが更新されます)

データベースから得る数値は出願～公開（登録）までのタイムラグの影響で CNIPA の数値にはすぐには到達しないし、公開前の出願取下げなどもあるので時間をおいても同一になることはありません。どのぐらいのタイムラグがあるかについては、次節「遅延公開・登録」で紹介します。

CNIPA の統計数値とデータベースから得られる数値を（特許に限定して）重ねると図2のようになります(2021/2/11 現在)。2019 年出願以降の乖離は主に公開のタイムラグによるものです。以前にも「早期公開特許」として紹介しましたように<sup>2)</sup> 出願～6 か月以内に公開されるものが全公開の 70%にも達していますので、日本など（出願～公開は 18 か月以降）とは違ってタイムラグは小さいのですが。

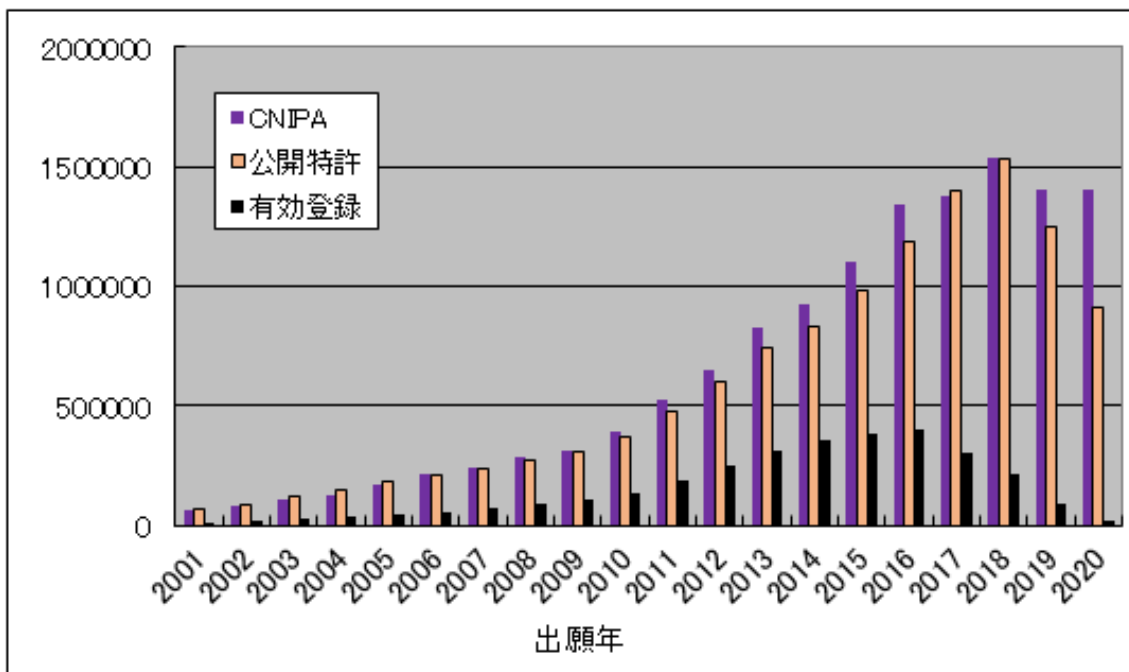


図2. 公開及び有効登録特許

また、日本版 CNIPR では有効な（生きている）特許・実用新案を抽出することもできますので図2に現時点（2021年2月）で有効な特許の推移についても示しました。図2のデータベースから検索した「公開特許」には出願して公開前に取下げられたものなどは含みませんが、審査未請求で見做し取下げになったもの、公開後取下げたもの、審査前及び審査中の未登録特許が含まれます。

公開特許も審査請求してはじめて審査されますが、出願～3年以内の期限内に審査請求しないと「見做し取下げ」となり失効します。（日本や韓国のように公開特許となる前には、審査請求しても審査されませんから「登録」になるようなことはありません）審査を経て登録となった特許も年金を納付してはじめて権利行使できる有効特許となります。そして、維持年金を納付し続けなければ失効します。

権利侵害調査（クリアランス調査）では、この有効なもの及び公開特許で失効しているものを除いて調査すればよいことになります。図2を見てお分かりのように出願特許（公開特許）に比べて、登録になり権利ある特許となるのはそれほど多くはないのです。特に、内国（中国）出願人が「登録」となった後、特許では10年以上年金を支払って権利維持しているケースは少ない状況です。

「最近の中国特許は把握しきれないほどの出願の伸び」と大騒ぎもされていますが、権利侵害調査の観点からはそうでもないのです。むしろ、調査対象の侵害性の有無を判断する内容の特許や実用新案を如何に洩れなく把握するか、の方が重要です。

死んだと思っていた特許が生き返ったりなど、特許情報の生死の議論は「東アジア特許の生死情報（その1. 中国）」<sup>3)</sup> や INFOPRO2015 での発表資料<sup>4)</sup> をご覧ください。

日本版 CNIPR の生死情報で、出願から20年以上（実用新案の場合には出願から10年以上）経過しているものがデータベースに「生」として存在している<sup>3)</sup> ということがありますが、逆に、出願から20年以内の特許（出願から10年以内の実案）についても本来は失効となっているにも拘らず「有効」なフラグが立って、「生きている」とされているものがあるかもしれません。生死情報の確認では、中国版 CNIPR など複数のデータベースでも調査が必要です。

## 2. 特許、実用新案の遅延公開・登録

各国特許法にも定められているように中国においても出願書類は「出願日から満18か月後に公開する。」（中国専利法第三十四条）とあり、同条には「出願者の請求に基づき、その出願を繰り上げて公開することができる。」（早期公開）ともあります。

日本や韓国、台湾などはほぼ規定通り18か月後に公開されていますが、中国の場合はむしろ早期公開の方が多いことをこれまでに紹介しました<sup>2) 5)</sup>。最近の早期公開（実案については早期登録）の動向を別表図にも紹介します。

本稿では早期公開とは別に出願から数年を経て公開される特許（遅延公開と定義）について議論することにします。

別表図1（早期公開特許）や別表図3（早期登録実用新案）で紹介した図では月単位に出願～公開（登録）がどの程度あるかをカウントしていますが（例えば2020年1月に出願された特許が2020年1月～6月までに公開されたものを「出願～6か月」としています）、遅延公開の議論ではもっと荒っぽく年単位としましたのでかなり違和感のある数値となっていることをご了解ください。

つまり、2019年1月～12月に出願されたものが2019年に公開になったもの、2020

年に公開になったものなどとしています。極端な場合、2019年12月31日に出願され2020年1月に公開されれば、「2019年出願で2020年公開」になったものとしてカウントしています。そりゃないよ、と言われそうですが。

遅延公開の議論でも少なくとも月単位のカウントにすればイメージの異なる情報になると思いますが、ここではざっくりと年単位での公開状況としました。(1日単位の出願～公開の推移については、研究会の西尾さんがJIPAセミナーで紹介しています。)

参考までに「月単位で取得している出願～公開」までの数値を別表図2に示しましたが、これでは出願から数年経て公開される特許について議論するのが難しいので「ざっくり」と(表1)。

表1. 中国公開特許の推移

	出願年	2001		2002		2003		2010		2011		2012	
	出願公開数	68,215		89,707		120,454		368,627		472,137		598,182	
公開年	公開件数	分割		分割		分割		分割		分割		分割	
2001年	50,364	8,144	0										
2002年	58,984	23,786	6	8,950	0								
2003年	77,472	23,929	15	32,989	8	14,146	0						
2004年	93,944	7,929	349	29,724	144	42,692	23						
2005年	155,446	1,998	905	13,126	684	46,650	269						
2006年	172,424	869	790	1,780	1,306	10,391	1,158						
2007年	208,345	577	552	1,159	1,118	2,545	2,176						
2008年	241,182	325	321	695	688	1,468	1,409						
2009年	281,006	294	289	548	535	932	884						
2010年	315,836	143	137	372	364	764	732	93,811	4				
2011年	368,434	84	83	139	139	325	325	142,508	124	113,822	19		
2012年	543,296	60	60	98	97	244	244	117,064	739	215,186	239	195,410	19
2013年	632,585	24	24	58	58	144	143	7,278	1,060	124,645	905	231,250	390
2014年	777,335	20	20	33	33	64	64	2,008	1,832	9,287	1,255	153,467	1,066
2015年	955,341	20	20	12	11	32	32	2,726	2,721	2,628	2,572	8,408	2,142
2016年	1,045,796	7	7	8	8	33	33	1,849	1,845	3,451	3,437	2,853	2,761
2017年	1,270,654	2	2	9	9	11	11	952	848	1,913	1,688	3,309	2,728
2018年	1,576,616	1	0	4	0	7	0	247	0	810	0	2,165	0
2019年	1,532,682	2	0	1	0	3	0	137	0	280	0	1,066	0
2020年	1,517,110	1	0	2	0	1	0	44	0	107	0	243	0

この年単位の出願年と公開年の情報は1990年以降、2020年末まで手元にありますが2001年出願のもの権利期間が2021年末までであることから2001年～2003年出願特許について議論したいと思います。

表1の左(2001年～2003年出願)を見てわかるように出願から5,6年経過しても、さらには15年以上経過してもなお公開されるものがあります。表1の右に示した2010年～2012年出願分の出願から12年以降については今後も同様に「公開」が続くということになります。

一方では、早期公開特許が他国に比べて多く、その多くが出願から18か月以内に公開される事実があるのに、出願から3年を過ぎてもなお公開されるものがある、ということは何故かと考えたときに、1つは分割の問題ではないかと分割の公開数についても



日本の場合にはさほどではありませんが、韓国の出願～3年以降の公開分には分割が増え、4年以降の案件ではほとんどが分割という状況です。KIPRISの場合には、分割情報を抽出するフィールドがなく、詳細情報中の Kind フィールドに「Divisional application」とあり、この情報で「分割」の確認ができます。また、韓国特許の分割案件の多くは PCT 特許のようですが、この点についてもさらに検証する必要がありそうです。

別表図 4 には中国特許登録の推移を示しました。審査に時間を要することもあり、出願から登録まで長期にわたることも理解できますが、中には出願から 15 年以上経過して登録されるものもあります。これもそこまで頑張って登録にしたものがどんな内容のものか興味があるところです。

別表図 5 には中国実用新案登録の推移を示しました。登録まで長期にわたるものはなさそうです。

別表図 6 に出願各年の分割出願数を示しました。

### 3. 中国特許出願番号付与の謎

どの国の出願番号も原則、出願日順に付与されるものと思われそうですが、中国では必ずしもそうでもないようです。

表 3. CN2010 年初公開特許出願番号

出願番号	出願日	公開番号	公開日	親出願番号
CN201010000001.8	2010.01.04	CN102116401A	2011.07.06	
CN201010000002.2	2010.01.04	CN101779810A	2010.07.21	
CN201010000003.7	2010.01.04	CN101779716A	2010.07.21	
CN201010000004.1	2010.01.04	CN101779811A	2010.07.21	
CN201010000005.6	2010.01.04	CN101779812A	2010.07.21	
CN201010000007.5	2010.01.04	CN102033644A	2011.04.27	
CN201010000008.X	2010.01.04	CN101927388A	2010.12.29	
CN201010000009.4	2010.01.04	CN101746990A	2010.06.23	
CN201010000010.7	2010.01.04	CN102118064A	2011.07.06	
CN201010000011.1	2010.01.04	CN102117705A	2011.07.06	
CN201010000012.6	2010.01.04	CN102116720A	2011.07.06	
CN201010000013.0	2010.01.04	CN102116721A	2011.07.06	
CN201010000014.5	2010.01.04	CN101799387A	2010.08.11	
CN201010000015.X	2010.01.04	CN102050182A	2011.05.11	
CN201010001463.1	2010.01.01	CN102116590A	2011.07.06	
CN201010001464.6	2010.01.02	CN102114820A	2011.07.06	
CN201010001465.0	2010.01.02	CN102117538A	2011.07.06	
CN201010001569.1	2010.01.03	CN102113790A	2011.07.06	
CN201010001570.4	2010.01.03	CN102113497A	2011.07.06	
CN201010001571.9	2010.01.03	CN102113493A	2011.07.06	
CN201010001573.8	2010.01.03	CN102114621A	2011.07.06	
CN201010001574.2	2010.01.01	CN101723033A	2010.06.09	
CN201010001577.6	2010.01.03	CN101716691A	2010.06.02	
CN201010001578.0	2010.01.03	CN101733452A	2010.06.16	
CN201010001579.5	2010.01.03	CN101791716A	2010.08.04	
CN201010001580.8	2010.01.03	CN101791699A	2010.08.04	
CN201010001581.2	2010.01.03	CN102113486A	2011.07.06	
CN201010001582.7	2010.01.03	CN102113495A	2011.07.06	
CN201010001583.1	2010.01.03	CN102113496A	2011.07.06	
CN201010001584.6	2010.01.03	CN102113506A	2011.07.06	

出願日

2010/1/1 111 件

2010/1/2 40 件

2010/1/3 24 件

2010/1/4 445 件

2010/1/5 772 件



表3は2010年の特許出願番号を昇順に並べ、出願日を確認したものです。2010年の最初の出願番号1番CN201010000001.8（ドット以下の1桁の番号は枝番）以下、15番までは1月4日出願になっています。1月1日～3日まではお正月でお休みかと思いきや、正月にも出願されています。

そして1月1日出願案件111件のうち、CN201010001463.1とCN201010001574は表3の下部に点在します。残りの109件はどこにあるのでしょうか。また、1月4日出願がCN201010039518.8ととんでもなくジャンプした番号でも存在します。

2020年1月1日出願特許も113件存在しますが、CN202010020281.2などとジャンプしています。

さらに年末の状況を見たものが表4です。出願番号を降順に並べています。

表4. CN2010年末公開特許出願番号

番号降順 出願番号	最大番号が何故年末ではない？ 出願日	公開番号	公開日	親出願番号
CN201010625356.6	2006.10.17	CN102819121A	2012.12.12	CN200680038438.2
CN201010625341.X	2010.06.24	CN102529815A	2012.07.04	
CN201010625292.X	2006.08.31	CN102182805A	2011.09.14	CN200680038664.0
CN201010625291.5	2003.11.05	CN102214410A	2011.10.12	CN200380102752.9
CN201010625286.4	2010.12.10	CN102225924A	2011.10.26	
CN201010625281.1	2010.12.15	CN102201333A	2011.09.28	
CN201010625276.0	2010.12.21	CN102180371A	2011.09.14	
CN201010625273.7	2010.12.23	CN102141086A	2011.08.03	
CN201010625272.2	2010.12.01	CN102166095A	2011.08.31	
CN201010625271.8	2010.12.24	CN102180134A	2011.09.14	
CN201010625267.1	2010.11.25	CN102886617A	2013.01.23	
CN201010625261.4	2010.12.30	CN102156145A	2011.08.17	
CN201010625257.8	2010.12.20	CN102110325A	2011.06.29	
CN201010625256.3	2010.12.17	CN102155777A	2011.08.17	
CN201010625254.4	2010.12.14	CN102178541A	2011.09.14	
CN201010625253.X	2010.12.28	CN102130593A	2011.07.20	
CN201010625252.5	2010.12.28	CN102163919A	2011.08.24	
CN201010625251.0	2010.12.10	CN102212100A	2011.10.12	
CN201010625248.9	2010.12.21	CN102152866A	2011.08.17	
CN201010625247.4	2010.12.16	CN102156095A	2011.08.17	
CN201010625246.X	2010.12.28	CN102130592A	2011.07.20	
CN201010625241.7	2010.12.24	CN102111556A	2011.06.29	
CN201010625238.5	2010.12.23	CN102109031A	2011.06.29	
CN201010625237.0	2010.12.22	CN102116888A	2011.07.06	
CN201010625236.6	2010.12.02	CN102178670A	2011.09.14	
CN201010625232.8	2010.12.28	CN102431234A	2012.05.02	
CN201010625231.3	2010.12.30	CN102153695A	2011.08.17	
CN201010625230.9	2010.12.10	CN102531917A	2012.07.04	

出願日	
2010/12/31	4085件
2010/12/30	3543件

出願番号CN2010の最大番号及び他の2件は分割出願案件なので別格としても、ここでも必ずしも最大番号が12月31日出願にはなっていません。年末の出願件数は以下のようになっています。

これらのことから中国の出願番号は出願日順に付与されている訳でもなさそうです。

では、台湾、韓国ではどうかも見てみましょう。

表 5. TW2010 年初公開特許出願番号

申請号	申請日	專利編號	公告/公開日
99100002	20100104	201028481	20100801
99100003	20100104	201030299	20100816
99100004	20100104	201124197	20110716
99100005	20100104	201125146	20110716
99100006	20100104	201125147	20110716
99100007	20100104	201124706	20110716
99100008	20100104	201125406	20110716
99100009	20100104	201125287	20110716
99100010	20100104	201037150	20101016
99100011	20100104	201040658	20101116
99100012	20100104	201043792	20101216

出願日	
2010/1/1	0 件
2010/1/2	0 件
2010/1/3	0 件
2010/1/4	37 件
2010/1/5	84 件

表 6. TW2010 年末公開特許出願番号

申請号	申請日	專利編號	公告/公開日
99147436	20101231	201226979	20120701
99147434	20101231	201227454	20120701
99147433	20101231	201228027	20120701
99147432	20101231	201226305	20120701
99147431	20101231	201215918	20120416
99147430	20101231	201228129	20120701
99147429	20101231	201227527	20120701
99147428	20101231	201226829	20120701
99147427	20101231	201226485	20120701

出願日	
2010/12/31	364 件
2010/12/30	324 件

表 7. KR2010 年初公開特許出願番号

Application No.	Application Date	Unex. Pub. No.	Unex. Pub. Date	Registration No.	Registration Date
1020100000001	2010.01.01			1010085140000	
1020100000003	2010.01.01	1020110079393	2011.07.07		
1020100000004	2010.01.01	1020110079394	2011.07.07		
1020100000005	2010.01.01	1020110079395	2011.07.07		
1020100000006	2010.01.01	1020110030254	2011.03.23	1011361130000	
1020100000007	2010.01.01	1020110030255	2011.03.23		
1020100000008	2010.01.01	1020110079396	2011.07.07	1016050760000	
1020100000009	2010.01.01	1020110079397	2011.07.07		
1020100000010	2010.01.02	1020110079784	2011.07.08		
1020100000011	2010.01.02	1020100010038	2010.01.29		

出願日	
2010/1/1	8 件
2010/1/2	6 件
2010/1/3	5 件
2010/1/4	274 件
2010/1/5	418 件

表 8. KR2010 年末公開特許出願番号

Application No.	Application Date	Unex. Pub. No.	Unex. Pub. Date	Registration No.	Registration Date
1020100140858	2010.12.31	1020120078527	2012.07.10		
1020100140856	2010.12.31	1020120078767	2012.07.11	10116780800	
1020100140854	2010.12.31	1020110010685	2011.02.07		
1020100140853	2010.12.31	1020120078526	2012.07.10		
1020100140849	2010.12.31	1020120078523	2012.07.10		
1020100140848	2010.12.31	1020120078522	2012.07.10		

出願日	
2010/12/31	1051 件
2010/12/30	1290 件

台湾や韓国では出願日順に出願番号も付与されています。



#### 4. 中国特許の出願番号密度（収録率）

データベースの収録率の1つの考え方として、データベースで検索した特定年の出願総件数をその年の出願番号最大値で除算した値を「出願番号密度」と定義した収録率をJETRO 報告書（「ASEAN6 各国知財庁が提供する産業財産権データベースの調査報告」）の中で研究会の中西さんが紹介しています。そこで、この「出願番号密度」という捉え方を中国特許収録状況の1つの指標として適用してみました。

表9は、出願番号を10000件ごとに区切ってその収録数を確認したものです。100%収録されていれば10000件となります。年号のすぐ後の数字1は内国出願特許、2は内国出願実用新案、8はPCTからの移行特許、9はPCTからの移行実用新案です。

表9. 中国公開特許の出願番号密度（内国出願特許）

2004出願		2005年出願		2006年出願		2007年出願	
CN20041000%	9,361	CN20051000%	8,548	CN20061000%	9,353	CN20071000%	9,444
CN20041001%	9,342	CN20051001%	9,258	CN20061001%	8,984	CN20071001%	8,834
CN20041002%	8,793	CN20051002%	9,360	CN20061002%	9,038	CN20071002%	8,844
CN20041003%	9,054	CN20051003%	8,639	CN20061003%	9,167	CN20071003%	7,798
CN20041004%	9,398	CN20051004%	9,109	CN20061004%	9,077	CN20071004%	8,950
CN20041005%	9,465	CN20051005%	8,192	CN20061005%	7,959	CN20071005%	7,997
CN20041006%	9,336	CN20051006%	9,468	CN20061006%	9,192	CN20071006%	8,497
CN20041007%	8,502	CN20051007%	9,408	CN20061007%	9,087	CN20071007%	9,298
CN20041008%	9,269	CN20051008%	9,461	CN20061008%	9,313	CN20071008%	5,944
CN20041009%	8,778	CN20051009%	9,101	CN20061009%	9,017	CN20071009%	8,207
CN20041010%	4,625	CN20051010%	9,328	CN20061010%	8,787	CN20071010%	9,323
CN20041011%	0	CN20051011%	9,258	CN20061011%	8,752	CN20071011%	7,718
CN20041012%	0	CN20051012%	9,009	CN20061012%	7,751	CN20071012%	9,123
CN20041013%	1	CN20051013%	6,865	CN20061013%	7,220	CN20071013%	8,661
CN20041014%	0	CN20051014%	0	CN20061014%	9,203	CN20071014%	9,214
	95,924	CN20051015%	0	CN20061015%	7,980	CN20071015%	7,733
		CN20051016%	0	CN20061016%	8,851	CN20071016%	9,133
CN20041%	96389	CN20051017%	0	CN20061017%	2,918	CN20071017%	7,970
最大番号		CN20051018%	0	CN20061018%	0	CN20071018%	5,848
CN200410130001		CN20051019%	0	CN20061019%	0	CN20071019%	7,798
マイナス20000		CN20051020%	742	CN20061020%	1,298	CN20071020%	3,237
CN200410110001と補正		CN20051021%	0	CN20061021%	0	CN20071021%	0
			125,746		152,947	CN20071022%	0
		CN20051%	125746	CN20061%	152947	CN20071023%	0
		最大番号		最大番号		CN20071024%	0
		CN200510200907		CN200610201509		CN20071025%	0
		マイナス60000		マイナス20000		CN20071026%	0
		CN200510140907と補正		CN200610181509と補正		CN20071027%	0
						CN20071028%	0
						CN20071029%	0
						CN20071030%	6,319
						CN20071031%	0
							175,890
						CN20071%	175890
						最大番号	
						CN200710308600	
						マイナス90000	
						CN200710218600と補正	

特許庁に出願した後、出願番号が付与され、公開までに取下げたり、特許庁からの対応にアクションしなかったりして見做し取下げになるものがあるので、台湾、韓国、日本の各国とも出願数の90%程度が公開特許としてデータベースに収録されます。(各国の収録状況は割愛します)

表9の内国特許の2005年出願番号で見ると、CN20051とつく公開特許は125,746件あります。そしてCN20051の最大番号はCN200510200907ですから、出願番号CN20051の収録率は $125,746/200,907=62.6\%$ ということになりますが、よく見ると最大出願番号が含まれるCN20051020%(742件)の前に60000件もの空白の部分があります。番号が空白の理由は定かではありませんが、この部分をゼロと見做して算出すると $125,746/140,907=89.2\%$ ということになります。

このように算出した修正前と修正後のデータが表10-1(空白部修正前)と表10-2(空白部修正後)となります。(但し、表中の数字は2016年に調査したもので2014年以降のデータは若干欠落もあります)

表10-1 (修正前)

出願番号 年号数字	公開出願 番号max	特許 公開数	公開 収録率	PCT出願 番号max	PCT 公開数	公開 収録率	実案出願 番号max	実案 登録数	登録 収録率	PCT出願 番号max	PCT 登録数	登録 収録率
2001	45,918	42,162	92%	23,958	23,674	99%	80,618	62,099	77%	7	5	71%
2002	61,142	56,048	92%	30,204	29,778	99%	95,806	73,809	77%	18	15	83%
~2003/9	78,800	54,101	69%	27,196	26,992	99%	84,900	60,888	72%	13	12	92%
2003/10~	26,702	23,061	86%	11,056	11,017	100%	32,308	22,662	70%	4	4	100%
2004	130,001	92,822	71%	44,897	44,703	100%	122,592	88,955	73%	47	45	96%
2005	200,907	125,746	63%	52,566	51,759	98%	200,914	106,337	53%	103	85	83%
2006	201,509	152,947	76%	56,947	56,637	99%	201,173	129,140	64%	103	94	91%
2007	307,539	175,890	57%	56,331	55,322	98%	312,400	150,436	48%	157	125	80%
2008	306,769	212,333	69%	58,550	56,631	97%	303,967	192,440	63%	522	174	33%
2009	313,012	241,962	77%	64,091	61,195	95%	353,600	269,375	76%	849	221	26%
2010	625,356	298,701	48%	71,274	66,639	93%	701,546	342,707	49%	886	419	47%
2011	463,521	394,681	85%	76,496	73,369	96%	580,046	485,003	84%	1,187	602	51%
2012	599,501	518,127	86%	78,249	75,691	97%	757,366	626,194	83%	1,387	811	58%
2013	757,522	654,797	86%	78,675	76,114	97%	897,498	640,870	71%	1,166	736	63%
2014	858,587	662,399	77%	44,837	37,140	83%	874,341	702,459	80%	627	204	33%
2015	1,035,767	639,145	62%	1,479	479	32%	1,014,692	671,707	66%	32	4	13%

表10-2 (修正後)

出願番号 年号数字	公開出願 番号max	特許 公開数	公開 収録率	PCT出願 番号max	PCT 公開数	公開 収録率	実案出願 番号max	実案 登録数	登録 収録率	PCT出願 番号max	PCT 登録数	登録 収録率
2001	45,918	42,162	92%	23,958	23,674	99%	80,618	62,099	77%	7	5	71%
2002	61,142	56,048	92%	30,204	29,778	99%	95,806	73,809	77%	18	15	83%
~2003/9	78,800	54,101	69%	27,196	26,992	99%	84,900	60,888	72%	13	12	92%
2003/10~	26,702	23,061	86%	11,056	11,017	100%	32,308	22,662	70%	4	4	100%
2004	110,001	92,822	84%	44,897	44,703	100%	122,592	88,955	73%	47	45	96%
2005	140,907	125,746	89%	52,566	51,759	98%	150,914	106,337	70%	103	85	83%
2006	181,509	152,947	84%	56,947	56,637	99%	181,173	129,140	71%	103	94	91%
2007	217,539	175,890	81%	56,331	55,322	98%	222,400	150,436	68%	157	125	80%
2008	256,769	212,333	83%	58,550	56,631	97%	253,967	192,440	76%	522	174	33%
2009	293,012	241,962	83%	64,091	61,195	95%	323,600	269,375	83%	849	221	26%
2010	385,356	298,701	78%	71,274	66,639	93%	481,546	342,707	71%	886	419	47%
2011	463,521	394,681	85%	76,496	73,369	96%	580,046	485,003	84%	1,187	602	51%
2012	599,501	518,127	86%	78,249	75,691	97%	757,366	626,194	83%	1,387	811	58%
2013	757,522	654,797	86%	78,675	76,114	97%	897,498	640,870	71%	1,166	736	63%
2014	858,587	662,399	77%	44,837	37,140	83%	874,341	702,459	80%	627	204	33%
2015	1,035,767	639,145	62%	1,479	479	32%	1,014,692	671,707	66%	32	4	13%

青くマークした部分が空白番号を修正したところです。修正によって内国出願特許ではほぼ 80%以上の収録率になりましたが、内国出願実用新案では 80%未満が多い状況です。PCT からの移行特許の収録率は極めて高い収録率を示していますが、実用新案はそうでもないようです。

出願番号空白の極め付きは 2010 年の出願番号です。CN20101%で収録されている総数は 298,703 件ですが、最大番号は何と CN201019176009 で、間に 1 万件単位で 124 万件もの空白があります。さすがにこれは表 10-1,10-2 では異常として処理しましたが、CN2010191%でカウントされる 338 件については後日その内容を検証してみたいと思っています。

何故このように（表 9）ジャンプした番号が付与されるのか中国特許庁に確認したいところです。また、出願番号の空白問題は置いておくとしても 10~20%のデータベース未収録（公開前取下げ、OA 未対応などによる見直し取下げ）がこんなに多いものと驚かされます。

## 5. まとめ

①特許も実用新案も急激な出願の伸びを示しているが、登録特許さらにはそれが生きている有効特許（権利ある特許）は出願数に比べるとかなり少ない。

審査前の有効な（生きている）公開特許及び審査中の公開特許を有効登録特許に加えて権利侵害調査の対象にし、調査対象分野に絞って調査する訳であるが、その数は驚くほど多くない。

②中国の公開特許は「出願から 1 年以内の早期公開」の比率が高く、出願から 3 年以上に公開になるものは少ないように思われるが、分割出願も多く出願から 5 年以上（場合によっては 10 年以上）、分割出願による公開が続く。

分割までして権利化する、そして 5 年や 10 年を経てまで分割出願する意味ある特許であるのかどうか検証してみたいものである。（いわゆる、それほどかわいいと思う子の「親の顔が見てみたい」というところ）

③台湾、韓国、日本などの出願番号は出願日順に付与されているが、中国特許の場合には出願日順に付与されているわけではなさそうです。

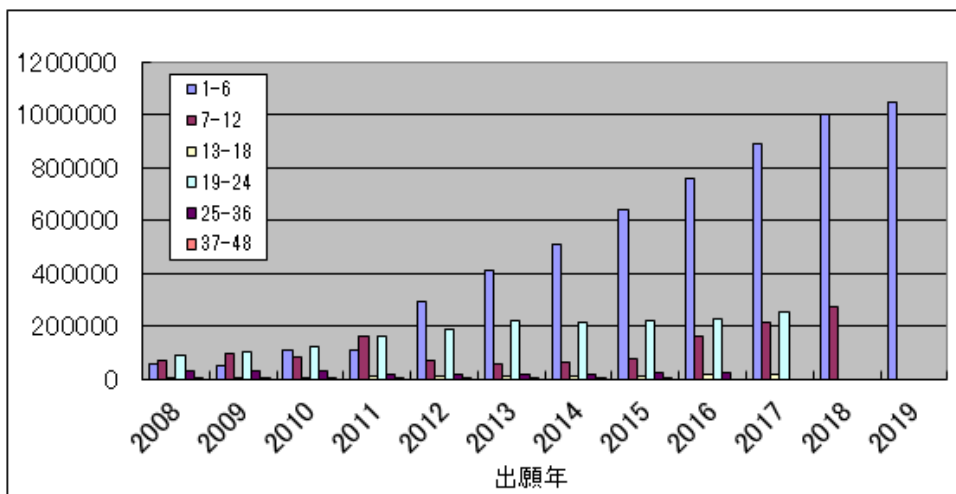
④中国特許のデータベース収録率を「出願番号密度」という観点から調べてみました。

中国国内（内国）に出願された特許の収録率は中国特許庁に出願された案件のおおむね 80~90%、内国出願の実用新案の収録率は同じく 70~80%、PCT から移行された特許はほぼ 100%ですが、PCT から以降の実用新案は母数も少ないせいか収録率にもばらつきが見られます。

まだまだ不明な点が多い中国特許情報ですが、解明までに至らずとも今後とも問題点を指摘していきたいと思っています。

余生もあとわずかというのにこんなつまらないことで時間をつぶして自己満足している昨今です。

別表図1：早期公開特許出願推移

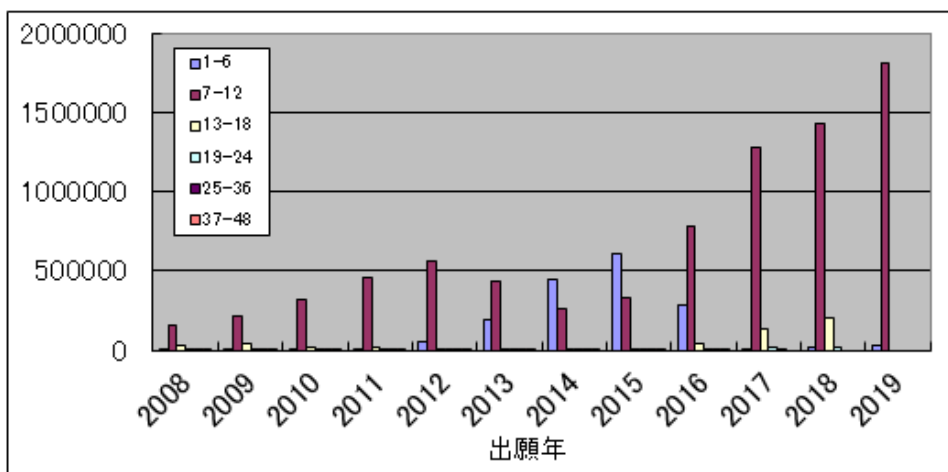


別表図2：早期公開特許出願推移も元データ

出願年	1-6	7-12	13-18	19-24	25-36	37-48	全公開
2008	61,150	68,770	6,651	94,397	29,953	2,890	270,281
2009	53,802	99,151	8,139	101,902	33,743	2,531	305,996
2010	112,079	84,369	7,796	125,937	29,446	1,895	368,627
2011	107,791	163,912	11,666	160,250	18,216	2,101	472,138
2012	294,914	74,199	11,508	188,519	17,844	2,757	598,185
2013	414,672	60,368	13,357	220,839	20,149	3,009	741,321
2014	508,267	64,710	12,944	217,168	17,552	3,382	831,848
2015	641,019	75,572	13,182	219,024	23,613	3,167	981,090
2016	755,743	159,890	16,149	229,099	22,499	3,497	1,189,463
2017	888,965	215,201	18,851	255,478	20,417	2021/11現在	1,401,315
2018	1,001,044	274,223	18,485	227,113	2021/11完		1,533,887
2019	1,046,927	94,813	2021/5完				1,258,713

出願年基準

別表図3：早期登録実用新案出願推移



別表図4：中国特許登録の推移

出願年	2001	2002	2003	2010	2011	2012
出願登録数	43,031	58,858	78,164	204,907	252,087	309,374
登録年	分割	分割	分割	分割	分割	分割
2000年	12,099					
2001年	16,937	0	0			
2002年	20,479	5	0			
2003年	35,932	1,564	0	0	0	0
2004年	49,409	10,607	3	5,483	0	587
2005年	51,503	13,136	20	13,638	13	8,493
2006年	58,374	8,429	156	15,109	91	16,837
2007年	65,786	3,394	382	9,596	288	17,266
2008年	89,955	2,579	395	6,751	562	14,244
2009年	128,685	1,874	417	4,698	693	11,871
2010年	129,896	551	232	1,488	413	4,607
2011年	164,126	255	184	670	433	1,577
2012年	217,803	296	212	669	436	1,368
2013年	219,579	149	123	331	229	639
2014年	230,349	68	61	125	102	253
2015年	333,294	47	45	96	86	190
2016年	418,845	49	45	63	49	133
2017年	420,348	19	19	28	26	53
2018年	432,340	4	0	16	0	33
2019年	452,973	3	0	5	0	11
2020年	530,328	2	0	3	0	1
2010年	5	0				
2011年	12,758	1	67	0		
2012年	56,519	42	19,620	6	37	0
2013年	45,244	138	65,413	61	21,521	4
2014年	38,734	346	51,458	289	75,099	101
2015年	32,366	533	55,648	438	84,313	365
2016年	13,815	877	43,312	692	78,434	713
2017年	2,617	1,107	10,095	936	32,401	807
2018年	1,528	0	3,683	0	12,019	0
2019年	939	0	1,762	0	3,520	0
2020年	353	0	955	0	1,843	0

別表図5：中国実用新案登録の推移

出願年	2010	2011	2012	2013	2014	2015
出願登録数	343,024	485,469	627,027	641,973	703,789	947,742
登録年	分割	分割	分割	分割	分割	分割
2010年	315,832	76,304	0			
2011年	404,520	263,410	59	134,408	0	
2012年	539,762	2,888	48	346,965	94	189,689
2013年	734,041	376	13	3,767	64	435,765
2014年	700,577	39	9	284	19	1,145
2015年	859,925	1	0	35	3	376
2016年	918,455	6	5	9	1	41
2017年	973,473	0	0	0	9	0
2018年	1,479,346	0	0	0	2	0
2019年	1,582,473	0	0	1	0	0
2020年	2,377,461	0	0	0	0	0
2010年						
2011年						
2012年				1		
2013年				123	294,079	2
2014年				35	345,108	178
2015年				20	2,372	57
2016年				5	342	6
2017年				0	69	6
2018年				0	2	0
2019年				0	1	0
2020年				0	0	0
2010年						
2011年						
2012年						
2013年						
2014年						
2015年						
2016年						
2017年						
2018年						
2019年						
2020年						

別表図6：出願各年の分割数

出願日	公開特許	登録特許	実用新案
2000	2,956	1,934	61
2001	3,580	2,294	58
2002	5,202	3,421	50
2003	7,503	4,595	52
2004	7,684	4,506	69
2005	7,351	4,657	101
2006	7,843	4,502	73
2007	7,868	4,463	66
2008	8,260	4,324	113
2009	8,671	3,830	134
2010	9,173	3,044	134
2011	10,115	2,422	181
2012	9,106	1,990	184
2013	8,375	1,540	249
2014	7,542	945	416
2015	4,970	320	663
2016	1,250	3	125
2017	88	0	5
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0

分割情報検索不可



別表図7：中国特許出願情報（WIPO35分類）

分類	分野	2005出願			2010出願			2015出願		
		公開	実案	登録	公開	実案	登録	公開	実案	登録
1	電気機械・装置、電気エネルギー	15,353	11,424	9,862	35,405	46,524	19,369	74,757	99,835	35,106
2	音響・映像技術	15,775	4,382	9,535	16,927	11,459	9,114	25,519	25,220	13,075
3	電気通信	13,265	2,248	6,982	14,017	6,827	8,335	23,835	13,815	11,984
4	デジタル通信	10,403	389	8,091	27,308	2,971	18,055	48,050	4,952	25,862
5	基本電気素子	2,361	489	1,594	3,159	1,246	2,175	4,830	2,341	3,036
6	コンピューターテクノロジー	15,924	3,074	9,966	28,101	6,965	15,993	75,143	15,261	39,247
7	ビジネス方法	1,512	80	345	3,139	360	549	16,079	2,239	3,619
8	半導体	9,999	950	7,406	15,544	3,515	9,943	20,503	5,608	12,541
9	光学機器	10,493	1,809	7,376	12,965	5,393	8,522	20,036	11,931	11,644
10	計測	11,190	5,927	6,763	26,633	21,141	16,263	70,628	60,743	36,981
11	生物材料分析	1,977	307	880	2,984	777	1,374	6,259	3,555	2,969
12	制御	3,866	3,123	2,023	8,544	9,389	4,422	30,011	33,346	12,728
13	医療機器	6,430	7,982	3,814	12,650	22,399	7,238	31,727	57,055	13,506
14	有機化学、化粧品	8,548	63	4,780	15,133	542	9,043	30,116	1,774	14,167
15	バイオテクノロジー	5,527	237	3,092	12,228	769	7,108	22,388	3,026	10,557
16	製薬	16,572	102	7,799	19,751	183	9,541	55,991	341	11,563
17	高分子化学、ポリマー	5,570	28	3,799	12,301	289	8,130	31,883	731	13,620
18	食品化学	5,199	433	2,533	12,967	1,962	5,616	53,858	6,933	7,612
19	基礎材料化学	8,708	548	5,027	19,460	2,292	10,907	52,918	5,984	17,507
20	無機材料、冶金	7,249	1,102	4,928	18,713	5,810	10,726	43,008	14,115	19,953
21	表面加工	4,743	1,291	3,046	10,079	5,725	5,662	22,701	16,331	9,838
22	マイクロ構造、ナノテクノロジー	500	9	336	1,411	64	957	3,779	165	2,335
23	化学工学	6,143	4,286	4,164	15,659	16,721	9,461	46,232	69,093	19,568
24	環境技術	3,466	2,763	2,134	10,909	9,817	6,031	30,852	36,383	13,083
25	ハンドリング機械	4,177	6,039	2,622	9,433	20,422	5,223	32,899	73,434	13,826
26	機械加工器具	5,189	5,724	3,420	15,028	24,721	8,203	48,192	78,719	20,311
27	エンジン、ポンプ、タービン	4,648	3,743	2,938	10,630	11,382	6,122	19,861	23,098	10,090
28	繊維、製紙	5,361	2,276	3,269	8,622	6,784	4,932	20,472	18,615	9,117
29	その他の特殊機械	6,494	5,699	3,912	16,011	16,854	8,540	56,259	63,828	20,422
30	熱処理機構	4,271	6,508	2,281	8,855	16,169	4,388	22,543	38,524	9,818
31	機械部品	4,948	6,353	3,176	11,912	21,358	6,713	28,486	50,223	12,562
32	運輸	5,717	6,430	3,783	12,968	18,138	7,774	35,649	48,964	17,927
33	家具、ゲーム	3,499	9,748	1,702	7,771	27,110	2,831	23,021	55,660	6,783
34	その他の消費財	4,366	8,114	2,240	8,168	21,301	3,585	22,980	38,731	7,241
35	土木技術	5,138	10,564	2,592	14,185	29,289	7,431	40,896	78,597	19,189

別表図8：中国特許分割情報（WIPO35分類）

分類	分野	2005出願			2010出願			2015出願		
		公開	実案	登録	公開	実案	登録	公開	実案	登録
1	電気機械・電気装置、電気エネルギー	475	13	334	628	20	252	613	194	17
2	音響・映像技術	878	2	619	517	17	201	74	18	12
3	電気通信	377	2	232	737	1	256	100	36	7
4	デジタル通信	716	1	540	1,081	1	241	70	2	6
5	基本電気素子	101	0	78	106	0	41	10	3	0
6	コンピューターテクノロジー	578	3	454	733	10	197	170	35	30
7	ビジネス方法	54	0	10	87	0	4	29	2	1
8	半導体	586	5	440	655	11	206	43	12	3
9	光学機器	552	1	406	544	4	246	132	15	0
10	計測	346	3	217	502	5	189	362	28	45
11	生物材料分析	81	0	37	122	0	31	148	0	11
12	制御	111	0	65	105	2	47	141	12	26
13	医療機器	418	8	279	575	4	194	212	34	9
14	有機化学、化粧品	517	0	250	643	0	182	172	0	3
15	バイオテクノロジー	441	1	214	585	0	135	146	2	3
16	製薬	808	0	303	1,060	0	202	212	0	9
17	高分子化学、ポリマー	214	0	143	290	0	95	159	0	10
18	食品化学	141	1	39	192	0	36	77	1	0

18	食品化学	141	1	39	192	0	36	77	1	0
19	基礎材料化学	409	0	224	540	1	185	175	2	7
20	無機材料、冶金	159	2	90	263	2	67	254	1	14
21	表面加工	190	2	125	217	2	74	85	6	2
22	マイクロ構造、ナノテクノロジー	43	0	22	44	0	12	7	0	2
23	化学工学	211	4	117	276	8	88	229	20	15
24	環境技術	91	2	55	151	7	59	242	7	11
25	ハンドリング機械	126	8	80	200	6	88	259	17	10
26	機械加工器具	144	14	88	122	1	54	818	24	19
27	エンジン、ポンプ、タービン	149	3	110	194	4	89	89	11	5
28	繊維、製紙	182	4	120	188	1	94	139	43	20
29	その他の特殊機械	210	4	144	287	5	110	333	20	22
30	熱処理機構	97	4	64	109	10	47	107	47	14
31	機械部品	143	11	97	185	4	76	125	19	8
32	運輸	153	3	105	203	1	99	136	19	11
33	家具、ゲーム	134	7	98	120	13	46	177	60	8
34	その他の消費財	107	8	69	197	1	94	190	57	25
35	土木技術	334	8	102	154	19	71	405	43	52

上記別表図のデータは 2021 年 2 月 11 日現在のものです。

参考文献：

1)CNIPA 統計情報

<https://www.cnipa.gov.cn/col/col61/index.html>

2) 中国早期公開特許

[http://patentsearch.punyu.jp/asia/CN\\_early2020.pdf](http://patentsearch.punyu.jp/asia/CN_early2020.pdf)

3) 東アジア特許の生死情報（その 1. 中国）

[http://patentsearch.punyu.jp/asia/CN\\_LS.pdf](http://patentsearch.punyu.jp/asia/CN_LS.pdf)

4)中国・台湾特許データベース法律状態情報活用

[http://patentsearch.punyu.jp/asia/INFOPRO2015\\_C41.pdf](http://patentsearch.punyu.jp/asia/INFOPRO2015_C41.pdf)

5) 中国における早期公開・早期登録特許の実態(2014)

[https://system.jpaa.or.jp/patents\\_files\\_old/201407/jpaapatent201407\\_079-085.pdf](https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201407/jpaapatent201407_079-085.pdf)

中国早期公開特許の最新動向(2019)

<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/292/292kiko01.pdf>

以上